

КВАНТОВОЕ АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТОНКИХ ПЬЕЗОПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНКАХ

Р. А. ГАСПАРЯН

Рассматривается задача о взаимодействии звуковых волн с дрейфующим потоком электронов в тонких размерно-квантованных пленках пьезополупроводников, когда выполняется квантовомеханическое условие $ql > 1$ (q — волновой вектор звука, l — средняя длина свободного пробега электрона). Найдена осцилляционная зависимость коэффициента усиления звука от толщины пленки.

В настоящее время исследования акустоэлектронных явлений проводятся с большой интенсивностью, так как многие из этих явлений уже нашли важное применение в разных областях микроэлектроники (см., например, [1]). Взаимодействию звука с электронами проводимости в пьезополупроводниках в квантовой области, когда выполняется условие $ql > 1$ (q — волновой вектор звука, l — средняя длина свободного пробега электрона), посвящен ряд работ [2—4], в которых рассматриваются массивные образцы. Когда толщина образца по порядку величины становится сравнимой с де-Бройлевской длиной волны электрона, заметную роль начинает играть квантовый размерный эффект [5].

Настоящая работа посвящена вычислению коэффициента усиления звука (КУЗ) в тонких размерно-квантованных пленках при условии $ql > 1$.

Пусть в пьезополупроводниковом образце n -типа с толщиной L_z в плоскости пленки в направлении оси x распространяется пьезоактивная волна вида $\exp\{i(qx - \omega t)\}$, где ω — частота звука, и в этом же направлении приложено постоянное поле E_0 . Отклик электронной подсистемы на внешние поля (электрическое и звуковое) удобно найти с помощью кинетического уравнения для одночастичной матрицы плотности, учитывающей эффект экранирования. Чтобы не повторять расчеты работы [3], мы не будем приводить решения этого уравнения. Отметим лишь, что в наших расчетах мы исходим из волновых функций и энергетического спектра электрона, соответствующих модели бесконечно-глубокой потенциальной ямы для электронов.

Для частотно-зависящей диэлектрической проницаемости в случае бесстолкновительного электронного газа ($\tau \rightarrow \infty$) с помощью матрицы плотности находим выражение

$$\varepsilon(q, \omega) = 1 + \frac{e^2}{\varepsilon_0 q^2} L(q, \omega), \quad (1)$$

где ε_0 — статическая диэлектрическая проницаемость, e — заряд электрона,

$$L(q, \omega) = V^{-1} \sum_{\mathbf{k}} \frac{f(\mathbf{k} - \mathbf{q}) - f(\mathbf{k})}{E_{\mathbf{k}} - E_{\mathbf{k} - \mathbf{q}} - \hbar\omega - i\hbar/\tau}, \quad (2)$$

$$f(\mathbf{k}) = \left\{ \exp \left[\frac{\hbar^2}{2mk_B T} \left[(k_x - k_d)^2 + k_y^2 + \frac{\pi^2}{L_z^2} v^2 \right] + \eta \right] + 1 \right\}^{-1}, \quad (3)$$

$$E_k = \frac{\hbar^2}{2mk_B T} \left[k_x^2 + k_y^2 + \frac{\pi^2}{L_z^2} v^2 \right], \quad (4)$$

m — эффективная масса электронов, v — номер пленочной подзоны, T и V — соответственно температура и объем кристалла, \hbar и k_B — постоянные Планка и Больцмана. Отметим, что смещение электронного распределения в k -пространстве происходит в области с размером $k_d = eE_0\tau/\hbar = mv_d/\hbar$, где $v_d = \mu E_0$ — дрейфовая скорость электронов.

Вычислим КУЗ по формуле

$$\Gamma = K^2 q \operatorname{Im} [\varepsilon^{-1}(q, \omega)], \quad (5)$$

где K — коэффициент электромеханической связи. Используя выражения (1) и (5), легко найти

$$\Gamma = \frac{K^2 q^3 \operatorname{Im} Q}{(q^2 + \operatorname{Re} Q)^2 + (\operatorname{Im} Q)^2}, \quad (6)$$

где введена функция $Q = [\varepsilon(q, \omega) - 1]q^2$.

Если дрейфовая скорость электронов — величина того же порядка, что и скорость звука, $v_d \sim v_s$, и гораздо меньше тепловой скорости электронов, $v_d \ll v_T$, то в первом приближении в разложении $\operatorname{Im} Q$ по величине $v_d - v_s/v_T \ll 1$ получаем

$$\operatorname{Im} Q = D \left(\frac{v_d}{v_s} - 1 \right) \sum_{\nu=1}^M F_{-3/2}(\eta - \delta_\nu), \quad (7)$$

где

$$D = \frac{me^2 v_s}{V \pi \varepsilon_0 \hbar^2 L_z v_T}, \quad v_T = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}},$$

$$\delta_\nu = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{q^2}{4} + \frac{\pi^2}{L_z^2} v^2 \right), \quad \eta = \frac{\varepsilon_F}{k_B T},$$

$$F_j(\eta) = \frac{1}{\Gamma(j+1)} \int_0^\infty \frac{x^j dx}{\exp(x - \eta) + 1} \quad \text{— интеграл Ферми, } \Gamma(j+1) \text{ — гамма-функция, } M \text{ — число заполненных подзон.}$$

Далее,

$$\operatorname{Re} Q = \Lambda^2 = Q_0 \sum_{\nu=1}^M \iint \frac{1}{k_x} \left[f_0 \left(k_x - \frac{q}{2} \right) - f_0 \left(k_x + \frac{q}{2} \right) \right] dk_x dk_y, \quad (8)$$

$$f_0 \left(k_x \pm \frac{q}{2} \right) = \left\{ \exp \left[\frac{\hbar^2}{2mk_B T} \left[\left(k_x \pm \frac{q}{2} \right)^2 + k_y^2 + \frac{\pi^2}{L_z^2} v^2 \right] - \eta \right] + 1 \right\}^{-1},$$

$$Q_0 = \frac{me^2}{2\pi^2 \hbar^2 \varepsilon_0 L_z q}.$$

При выводе (8) мы приняли $k_d \ll k_F$ и $k_F \sim q$. В приближении, когда $|\operatorname{Re} Q| \gg \operatorname{Im} Q$, с помощью (6) — (8) получаем

$$\Gamma = \frac{\pi \hbar \omega K^2}{2 k_B T L_z} \frac{q^2 q_c^2}{(q^2 + \Lambda^2)^2} (v_d/v_s - 1) \sum_{\nu=1}^M F_{-3/2}(\eta - \xi_\nu), \quad (9)$$

где

$$q_c^2 = \frac{N_c q^2}{\epsilon_0 k_B T}, \quad N_c = \left(\frac{m k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}.$$

Как видно из (8) и (9), Λ играет роль обратной величины радиуса экранирования и зависит как от толщины пленки, так и от волнового вектора звука. При этом зависимость от толщины пленки носит осцилляционный характер. В случаях невырожденного и полностью вырожденного электронного газа можно вычислить обратную величину квадрата радиуса экранирования в первом приближении относительно разложения (8) по степеням q . Для невырожденной и полностью вырожденной статистики соответственно получаем

$$\Lambda_{\text{нв}}^2 = 2\pi Q_0 e^\eta \sum_{\nu=1}^M \exp[-\xi_\nu], \quad (10)$$

$$\Lambda_{\text{в}}^2 = 2\pi Q_0 \sum_{\nu=1}^M \vartheta(\xi_\nu - \eta), \quad (11)$$

где

$$\vartheta(\xi_\nu - \eta) = \begin{cases} 1 & \xi_\nu < \eta \\ 0 & \xi_\nu > \eta \end{cases},$$

$$\xi_\nu = \frac{\hbar^2}{2m k_B T} \frac{\pi^2}{L_z^2} \nu^2.$$

Отметим, что выражения (9) — (11) в предельном случае массивных образцов, когда $L_z \rightarrow \infty$ и $M \rightarrow \infty$, при переходе от суммирования к интегрированию переходят в соответствующие формулы работы [4] для массивного образца.

Анализ показывает, что с увеличением толщины пленки КУЗ уменьшается обратно пропорционально толщине в пределах данной пленочной подзоны с номером ν . С появлением новой $(\nu + 1)$ -подзоны КУЗ скачкообразно растет, повторяя скачкообразное изменение плотности состояния пленки.

Как в пределах одной подзоны, так и с учетом всех подзон выражение (9) для КУЗ дает резонансную зависимость от частоты звука. Если пренебречь слабой зависимостью квадрата обратной величины радиуса экранирования Λ^2 от волнового вектора в (9), то найдем резонансную частоту $q_{\text{рез}} = \sqrt{3} \Lambda$, при которой КУЗ имеет пик. Примечательно, что $q_{\text{рез}}$ однозначно зависит от толщины пленки, что позволяет предложить новые методы измерения частоты (в зависимости от толщины) или толщины (в зависимости от частоты). Следует отметить, что при низких температурах из-за уменьшения значения интеграла Ферми при $\eta - \delta^\nu < 0$ КУЗ так-

же резко уменьшается и стремится к нулю. В образцах с толщиной 10 мкм уже наблюдалось такое резкое уменьшение акустоэлектронного взаимодействия при $q > 2k_F$.

В рассматриваемом случае размерно-квантованных пленок значения волнового вектора, при которых наблюдается резкое уменьшение акустоэлектронного взаимодействия, даются условием $\frac{q^2}{4} > k_F^2 - \frac{\pi^2}{L_z^2} v^2$, из которого видно, что имеет место зависимость от толщины пленки. Следовательно при данной приложенной звуковой частоте и данной энергии Ферми однозначно выбирается толщина (при данном номере подзоны), при которой КУЗ будет иметь резкий спад. Экспериментальное наблюдение такого резкого спада в разных пьезоактивных кристаллографических направлениях позволит предложить акустический метод построения плоского сечения поверхности Ферми с данным номером v . Присоединив картины разных энергетических подзон, можно получить также общий вид поверхности Ферми в размерно-квантованных пьезополупроводниковых пленках.

Следует отметить, что электронные столкновения сгладят резкое изменение КУЗ. Анализ роли столкновений при усилении звука представляет самостоятельный интерес и требует отдельного подробного исследования.

Оценим КУЗ для пленки из *InSb*. При

$$K^2 = 1,5 \cdot 10^{-3} [6], n = 2 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}, E = 60 \text{ В/см}, \mu = 6 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В сек},$$

$$L_z = 9 \cdot 10^{-6} \text{ см}, \epsilon_0 = 17, T = 4,2^\circ \text{ К}$$

получаем

$$\Gamma = 6,5 \text{ см}^{-1}.$$

Эффект усиления можно намного увеличить, если взять многослойную структуру. В этом случае КУЗ увеличится пропорционально числу пленочных слоев в структуре.

В заключение выражаю признательность Ю. В. Гуляеву и В. С. Сардаряну за внимание к работе.

Институт радиофизики
и электроники АН АрмССР

Поступила 20.II.1977

ЛИТЕРАТУРА

1. Л. Кайно. ТИИЭР, 64, № 5 (1976).
2. D. G. Carlson, A. Segmüller. J. de Phys., 33, Suppl., C4, 81 (1972).
3. E. Mosekilde. J. Appl. Phys., 43, 4957 (1972).
4. E. Mosekilde. Phys. Rev., B9, 682 (1974).
5. Б. А. Таггер, В. Я. Демиковский. УФН, 96, 61 (1968).
6. Дж. Блекмор. Статистика электронов в полупроводниках, Изд. Мир, М., 1964.

ՔՎԱՆՏԱՑԻՆ ԱԿՈՒՍՏՈՒԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՓՈՒՍԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՐԱԿ ՊՅԵԶՈՒԿԻՍԱԼԱՂՈՐԴՉԱՑԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐՈՒՄ

Ռ. Հ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Քննարկվում է ձայնի ափսոսողիկարական փոխազդեցությունը էլեկտրոնային հոսքի հետ բարակ, ըստ շախտերի քվանտացված պլեզոկիսահաղորդչային թաղանթներում, երբ տեղի ունի $ql > 1$ քվանտամեխանիկական պայմանը (q - ձայնի ալիքային թիվն է, l - էլեկտրոնի միջին ազատ վազքի երկարությունն է)։ Գտնված է ձայնի ուժեղացման գործակցի օսցիլյացիոն կախվածությունը թաղանթի հաստությունից:

QUANTUM ACOUSTOELECTRIC INTERACTION
IN THIN PIEZOSEMICONDUCTOR FILMS

R. A. GASPARYAN

The interaction of acoustic waves with an electron flux in thin dimensionally quantized piezosemiconductor films under the quantum mechanical condition $ql > 1$, where l is the mean free path of an electron and q is the acoustic wave vector, is discussed. The oscillation dependence of the acoustic gain coefficient on the film thickness is obtained.